Tecnologia delle fibre ottiche

Classificazione delle fibre ottiche in base al materiale costituente

Fibre di materiale plastico

(nucleo di polistirene e mantello di polimetilmetacrilato)

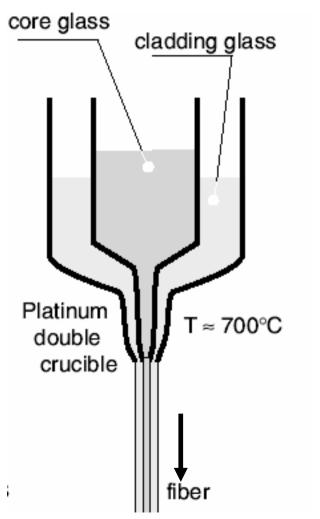
Fibre di vetri multicomponenti

(borosilicati, etc.)

Fibre in vetro di silice

Tecnologia delle fibre ottiche di vetri multicomponenti

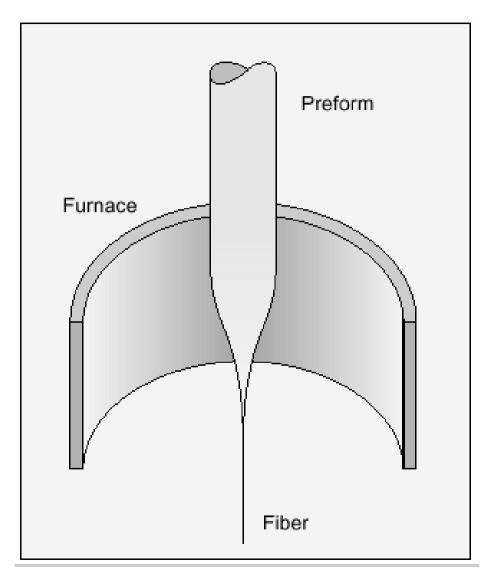
Metodo del doppio crogiolo



Optoelettronica - M. Brenci

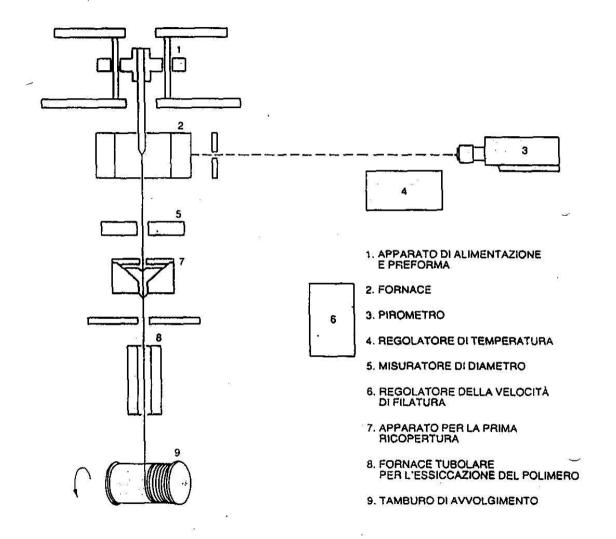
Tecnologia delle fibre di silice

Metodo della preforma



Optoelettronica - M. Brenci

Sistema di "tiraggio" delle fibre ottiche di silice



Realizzazione della preforma Chemical vapour deposition (CVD)

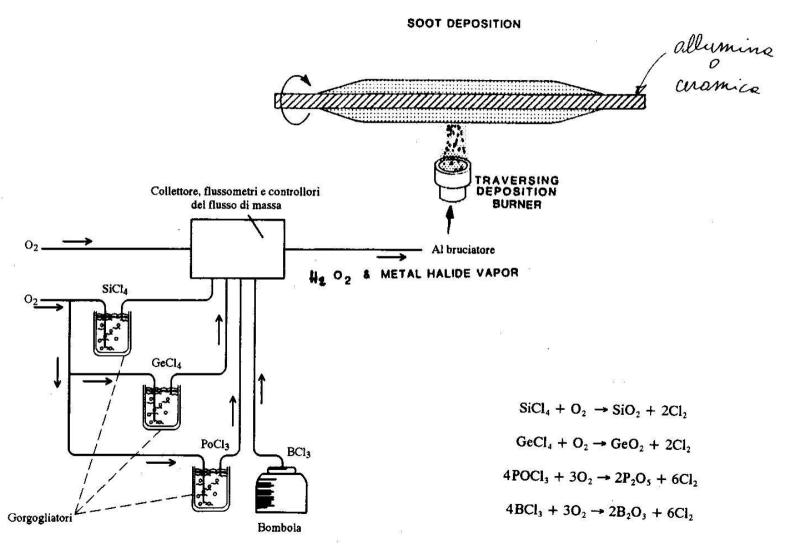
Obbiettivo: realizzazione di silice sintetica drogata opportunamente:

Le principali reazioni di deposizione che hanno luogo sono:

$$SiCl_4 + O_2 ---> SiO_2 + 2Cl_2$$
 $GeCl_4 + O_2 ---> GeO_2 + 2Cl_2$
 $4BCl_3 + 3O_2 ---> 2B_2O_3 + 6Cl_2$
 $SiF_4 + O_2 ---> SiO_2(F) + F_2$
 $4POCl_3 + 3O_2 ---> 2P_2O_5 + 6Cl_2$

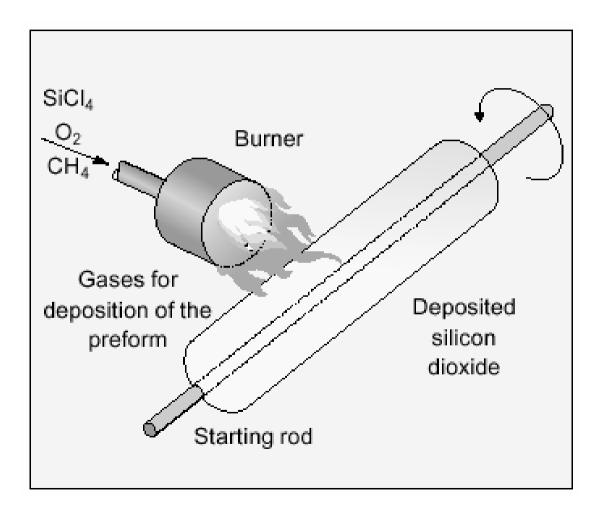
Processo di "Soot deposition" -

OVPO (Outside Vapour Phase Oxidation)

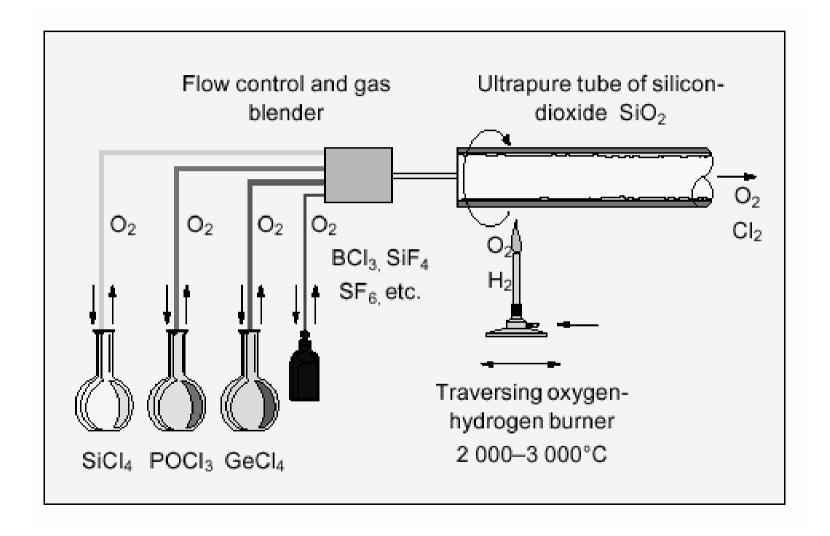


Optoelettronica - M. Brenci

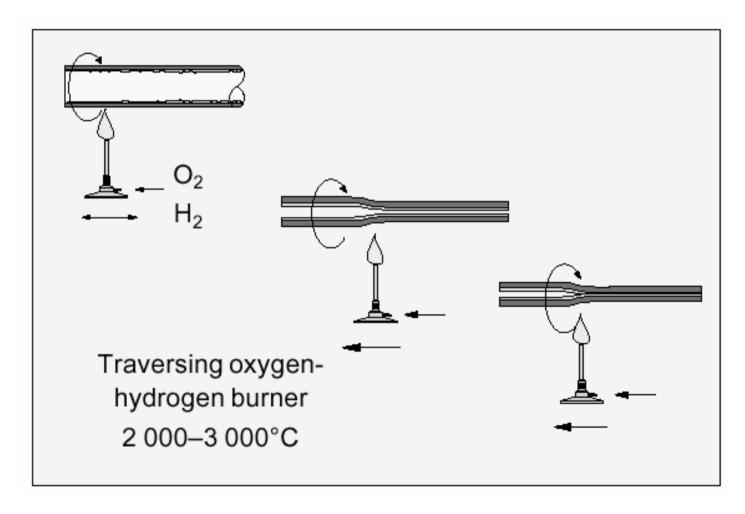
Outside Vapor Deposition



Modified CVD - IVPO (Inside Vapour Phase Oxidation)

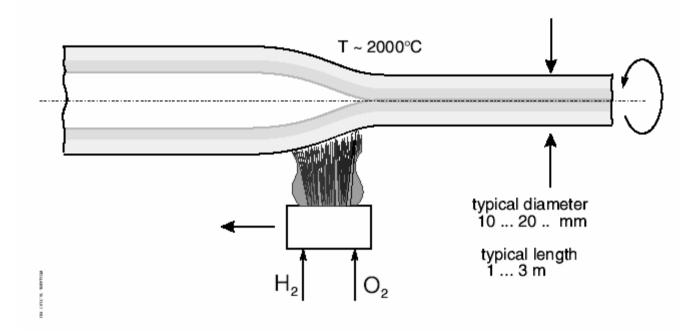


Collapsing the preform



fabrication of silica optical fibers

(2) collapsing the preform: under the influence of surface tension at the outside and inside wall of the preform tube





Optoelettronica - M. Brenci

Preform: material depositing Modified Chemical Vapor Deposition

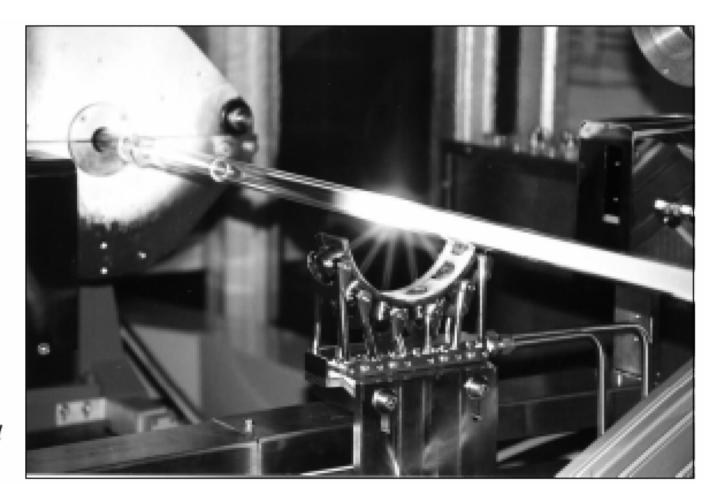
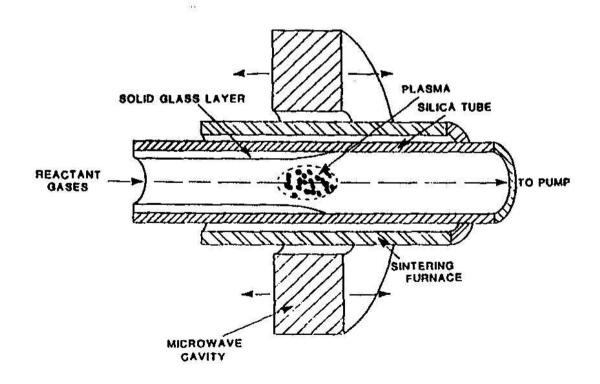


Fig. 3-4
MCVDdeposition at
Acreo Fiber
Lab
in Hudiksvall
Sweden

CVD ATTIVATO MEDIANTE PLASMA (PCVD)

- → Processo IVPO
- → Formaz. ossidi provocata da un plasma (cavità rison. f=2-3 GHz; P=100-550 W)



Optoelettronica - M. Brenci

Processo continuo VAD (Vapour Phase Axial Deposition)

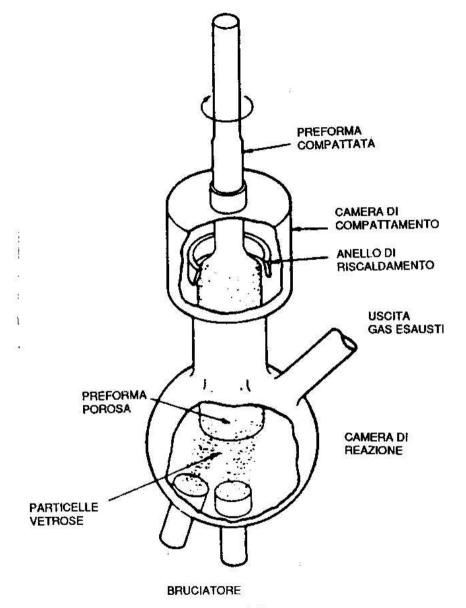


Fig. 4 - Schema del processo VAD

Optoelettronica - M. Brenci